Welcome to espacenet If this is not your first visit and some time has passed, you may expendence reduced navigation until you perform a search.

#### METHOD FOR PRODUCING PRINTING PLATE

Publication number: JP2001125282 (A)

Publication date: 2001-05-11

Inventor(s): TANAKA MIKIO; KASAKURA AKIO +

Applicant(s):

MITSUBISHI CHEM CORP +

Classification:

-international: G03F7/32; G03F7/32; (IPC1-7): G03F7/32

- Europeani

Application number: JP19990301833 19991025

Application number: JP19990301833 19991025 Priority number(s): JP19990301833 19991025

### Abstract of JP 2001125282 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a meltod for producing a printing pilet free from soil in the mon-image area and capab for it shiply lights a print free from votels table to defentive sticking of first to the limit part of the printing area. SOLUTION: A photosenality piancyraphic printing pilet with a photosensitive layer comprising a photosensitive comparison on the surface of the substrate is prepared and the photosensitive layer is imagewise exposed, developed with an alkali developing solution and washed with washing waster containing a development in the printing pilet.

Data supplied from the espacenet database --- Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-125282 (P2001-125282A)

(43)公開日 平成13年5月11日(2001.5.11)

(51) Int.Cl.7 G03F 7/32 證別記号 501

FΙ G03F 7/32

テーマコート\*(参考) 501 2H096

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 23 頁)

(21)出魔番号

特局平11-301833

(22) 出顧日

平成11年10月25日(1999, 10, 25)

(71)出網人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 5番 2 号

(72) 発明者 田中 弥公夫

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 笠倉 暁夫

神奈川県横浜市青葉区鳴志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(74)代理人 100103997

弁理士 長谷川 啖司

Fターム(参考) 2H096 AA07 BA16 BA20 EA04 CA08

GA09 GA11 GA17 GA18

(54) 【発明の名称】 印刷版の製造方法

(57)【剪約】

【誤題】 非画像部での汚れ、及び画像部でのインキ付 着不良による白抜け等がない印刷物を安定して得ること ができる印刷版の製造方法を提供する。

【解決手段】 支持体表面に感光性組成物からなる感光 性層が形成された感光性平版印刷版の該感光性層を画像 鬱光し、アルカリ現像液にて現像処理した後、消泡剤を 含有する水洗水にて水洗処理する印刷版の製造方法。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体表面に感光性組成物からなる感光 性層が形成された感光性平原印閉脈の誘感光性層を画像 露光し、アルカリ現像液にて現像処理した後、消泡剤を 含有する水洗水にて水洗処理することを特徴とする印刷 断の製造方法。

【請求項2】 水洗水中の消泡剤の含有量が10~1 0,000ppmである請求項1に記載の印刷版の製造 方法。

【請求項3】 消泡剤がシリコーン系消泡剤である請求 10 項1 又は2 に記載の印刷版の製造方法。

【請求項4】 水洗水による水洗処理を、現像処理した 印刷版面へ水洗水を液滴状で供給することにより行う請 求項1万至3のいずれかに記載の印刷版の製造方法。

【請求項5】 水洗水による水洗処理を、水洗水槽に貯水した水洗水を循環させながら行う請求項1乃至4のいずれかに記載の印刷版の製造方法。

【請求項6】 アルカリ現像液が、アルカリ金属の水酸 化物とアルカリ金属の珪酸塩とを含有する請求項1乃至 5のいずれかに記載の印刷版の製造方法。

【請求項7】 アルカリ現像液が界面活性剤を含有する 請求項1乃至6のいずれかに記載の印刷版の製造方法。 【請求項8】 アルカリ現像液中の界面活性剤の含石量

が10~50,000ppmである請求項7に記載の印刷版の製造方法。

【請求項9】 感光性組成物が、画像露光光源の光を吸収して熱に変換する光熱変換物質とアルカリ可溶性樹脂 とを含有するものである請求項1乃至8のいずれかに記 載の印刷版の製造方法。

【請求項10】 アルカリ可溶性樹脂がノボラック樹脂 30 を含み、感光性平版印刷版がボジ型である請求項9に記載の印刷版の劇者方法。

【請求項11】 画像露光を、波長域650~1,300nmの範囲のレーザー光により行う請求項1乃至10のいずれかに記載の印刷版の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発卵の解する技術分野】 本発明は、自帰版の製造方法 に関し、更に詳しくは、炭赤外線領域に対して高級政な 感光性和成物からなる吸光性解を有する感光性や脱臼網 40 版を、半等体レーザーやYAGレーザー等によって直接 製版してボシ型平版印刷版を製造するに好適な印刷版の 製造方法に関する。

#### [00002]

【従来の技術】コンピュータ画像処理技術の進歩に伴い、デジタル画像情報から、銀塩マスクフィルムへの出力を行わずに、レーザー光波のはサーマルーッド等により、直接レジスト画像を形成する感光又は感熱ダイレクト製版システムが注目されている。特に、高出力の半導体レーザーやアイム GLサーディス 企業が保証の

ーザー感光ダイレクト製版システムは、小型化、製版作業時の環境光、及び版材コスト等の面から、その実現が 強く望まれていた。

【0003】一方、従来より、レーザー感光又は感熱を 利用した画像形成方法としては、昇華転写色素を利用し 色材画像を形成する方法並びに平版印刷版を作製する方 法等が知られており、又、近年においては、化学増幅型 のフォトレジストに長波長光線吸収色素を組み合わせた 技術が散見されるようになった。例えば、特開平6-4 3633号公報には、特定のスクアリリウム系色素に光 酸発生剤及びバインダーを組み合わせた感光性材料が開 示されており、又、これに類する技術として、特開平7 -20629号公報には、赤外線吸収色素、潜伏性プレ ンステッド酸、レゾール樹脂及びノボラック樹脂を含む 感光件組成物層を半導体レーザー等により像状に露光し 平版印刷版を作製する方法が、特開平7-271029 号公朝には、前記潜伏性プレンステッド酸に代えs-ト リアジン系化合物を用いる方法が、更に、特開平9-4 3847号公報には、赤外線の照射により加熱して感光 20 材の結晶性を変化させるレジスト材及びそれを利用した パターン形成方法が、又、特開平10-3165号公報 には、アクリル系樹脂等をバインダーとして特定の溶解 抽止剤と赤外線吸収色素とを組み合わせた感光性組成物 が、それぞれ間示されている。

(00 4 】 平阪印間院にこれちの感光性組成物を用いた場合、その多くはアルカリ現像波によって現像処理されるが、本発明者等の検討によれば、得ちれる画像に財明性や安定性等を付ちずるためにそのアルカリ現像液に、昇面落性剤が添加されること等もあって、通常族されるその後の水洗処理において、往々にして水洗水槽中に泡沫が発生し、その液はが、隔壁により仕切られたその前の現像工程におけるもの表が表情や、同じく隔壁により仕切られたその前の現像工程における場合が、同じく隔壁により仕切られたその後の不感前に等のためのガム引き工程におけるガム液槽に流れ込んで、現像、水洗、及びガム引きにおけるボタールで割り煮した、結果として、得られる平版印刷版を用いて印刷される印刷物の非論像部に汚れが生じたり、画像部にインキ付着不良による行は皮けが生じる等の間顕本者は足いなるとが即即した。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、前述の従来 技術に鑑みてなされたものであって、非画像部での汚 れ、及び画像部でのインキ付着不良による白抜け等がな い印刷物を安定して得ることができる印刷版の製造方法 を提供することを目的とする。

#### [00006]

温潤を解決するための手段】本発明者等は、前記課題 を解決すべく解放検討した結果、現像処理後の販面を消 液剤を含有する水洗水で水洗処理することにより前記目 的が遠破できることを見い刊にを列程を完成したもので あって、即ち、本発明は、支持体表面に感光性組成物か 3 らなる感光性層が形成された感光性平散印刷版の該線光 性層を画像鏡光し、アルカリ現像液にて現像処理した 後、消泡剤を含有する水洗水にて水洗処理する印刷版の 製造方法、を要旨とする。

## [0007]

[008]本発明において感光性組成物として好ましいとする、光熱変換物質とアルカリ可緒性樹脂を含有するボジ型感光性組成物における光熱変独物質としては、画像端光光流の光を吸収して熱に変換し得る化合物であれば特に限定されないが、波長域650~1、300mの種間の一部又は全部に吸収帯を有する光吸収色素が特に有効である。これらの光吸収色素は、前部液長域の半

\* 光を効率よく吸収する一方、紫外線領域の光は殆ど吸収 しないか、吸収しても実質がに感じせず、白色灯に含ま れるような弱い紫外線によっては感光性組成物を変成さ せる作用のない化合物である。

【0003】 本発射において、これらの色素としては、 窒素原子、 健業原子、 又は硫黄原子等の複素原子がポリ メチン (一CH=)。 質で結合された構造のものであ り、代表的には、その複素原子が複素環を形成し、ポリ メチン類を介して複素環か結合された構造の所部、広義 10 のシアニン系色素、具体的には、例えば、キノリン系 (所課、 狭養のシアニン系)、インドール系 (所謂、 イ ンドシアニン系)、ペングチアゾール系 (所謂、 オオシ アニン系)、ピリリウム系、チアピリリウム系、スクア リリウム系、クロコニウム系、アズレニウム系等。 及 び、ポリメチン類を介して非電式複素原子が給合された 構造の所謂、ポリメチン系色素等が挙げられ、中で、キ ノリン系、インドール系、ペングチアゾール系、ピリリ ウム系、チアピリウム系等のシアニン系色素、及びポ リメチン系色素が好ましい。

[0010] 又、その他に、ジイミニウム系色素、フタロシアニン系色素等も代表的なものとして挙げられ、中で、ジイミニウム系色素が好ましい。 [0011] 本効明においては、前心シアニン系色素の中で、キノリン系色素の中で、は、特に、下記一般式(10)で妻されるものが好ましい。

[0012] 【化1】

【0013】 〔式(1a)、(1b)、及び(1c)中、R<sup>1</sup> 及びR 基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を は各々独立して、置換基を有していてもよいアルキル 50 有していてもよいアルキニル基、又は置換基を有してい てもよいフェニル基を示し、L' は置換基を有していて もよいトリ、ペンタ、ヘプタ、ノナ、又はウンデカメチ ン基を示し、該ペンタ、ヘプタ、ノナ、又はウンデカメ チン基上の2つの置換基が互いに連結して炭素数5~7 のシクロアルケン環、シクロアルケノン環、シクロアル ケンジオン環、又はシクロアルケンチオン環を形成して いてもよく、キノリン環は置換基を有していてもよく、 その場合、隣接する2つの置換基が互いに連結して縮合 ベンゼン環を形成していてもよい。X は対アニオンを 示す。〕

【0014】 ここで、式(la)、(lb)、及び(lc)中のR<sup>1</sup> 及びR がアルキル基であるときの炭素数は通常1~1 5、好ましくは1~10、アルケニル基、アルキニル基 \* 0であり、フェニル基も含めたそれらの置換基として コキシ基、フェノキシ基、ヒドロキシ基、又はフェニル 基等が挙げられ、L' における置換基としては、同上炭 素物のアルキル基。アミノ基、又はハロゲン原子等が挙 げられ、キノリン環における置換基としては、同上炭素 **勃のアルキル基**。同上炭素数のアルコキシ基。ニトロ 基、又はハロゲン原子等が挙げられる。

【0015】又、インドール系、及びベンゾチアゾール 10 系色素としては、特に、下記一般式(11)で表されるもの が好ましい。

(II)

[0016] 【化2】

であるときの炭素数は通常2~15、好ましくは2~1\* X-R3

【0017】 (式(II)中、Y 及びY は各々独立し て、ジアルキルメチレン基又は硫黄原子を示し、R<sup>3</sup>及 びR'は各々独立して、置換基を有していてもよいアル 基を有していてもよいアルキニル基、又は置換基を有し ていてもよいフェニル基を示し、L'は置換基を有して いてもよいトリ、ペンタ、ヘブタ、ノナ、又はウンデカ メチン基を示し、該ペンタ、ヘプタ、ノナ、又はウンデ カメチン基上の2つの置換基が互いに連結して炭素数5 30 ~7のシクロアルケン環、シクロアルケノン環、シクロ アルケンジオン環、又はシクロアルケンチオン環を形成 していてもよく、総合ベンゼン環は置換基を有していて もよく、その場合、隣接する2つの置換基が互いに連結 して縮合ベンゼン環を形成していてもよい。X は対ア ニオンを示す。〕

【0018】 ここで、式(II)中のR BびR がアルキ

ル基であるときの炭素数は通常 1~15、好ましくは1 ~10、アルケニル基、アルキニル基であるときの炭素 数は通常2~15、好ましくは2~10であり、フェニ ル基も含めたそれらの置換基としては、炭素数が通常1 ~15、好ましくは1~10のアルコキシ基、フェノキ シ基、ヒドロキシ基、又はフェニル基等が挙げられ、L \* における置換基としては、同上炭素数のアルキル基、 アミノ基 又はハロゲン原子等が挙げられ、縮合ベンゼ ン環における置換基としては、同上炭素数のアルキル 基、同上炭素数のアルコキシ基、ニトロ基、又はハロゲ ン原子等が挙げられる。

【0019】又、ピリリウム系、及びチアピリリウム系 色素としては、特に、下記一般式(IIIa)、(IIIb)、又は (IIIc)で表されるものが好ましい。

[0020]

[化3]

(5)

$$Z^{1+} = C = C = C = Z^{1}$$

$$Z^{1+} = C = C = Z^{1}$$

$$Z^{1+} = Z^{1} = Z^{1} = Z^{1}$$

$$Z^{1+} = Z^{1} = Z^{1} = Z^{1} = Z^{1}$$

$$Z^{1+} = Z^{1} = Z^{1}$$

[0021] に状(IIIa)、(IIIb)、及び(IIIc)中、2 及び2 は各々独立して、酸素原子又は蘸黄原子を示 し、R 、R R 、R で 及び8 は各々独立して、水素 原子又はアルキル基、又は、R とR 、及び8 とR 。 が互いに連結して炭素数5又は6のシクロアルケン環 を形成していてもよく、1 は置換熱を有していてもよ いモノ、トリ、ペンタ、又はヘブタメチン基を示し、該 トリ、ペンタ、又はヘブタメチン基上の2つの配換急が 30 ロアルケンプス、シクロアルケンジオン環、シク ロアルケンプス、シクロアルケンジオン環、又はシクロ アルケンチオン環を形成していてもよく、ピリリウム環 及びチアピリリウム環は置除基を有していてもよく、そ の場合、際体で3 2つの間除りが近いては続いる。

【002 25】 (式(I))中、R"、R"、R"、及びR"は各々独立して、アルキル基を示し、R"及びR"は各々独立して、関党基を有していてもよいアリール基、フリルは、又はチエニル基を示し、L"は関係基を有していてもよいモノ、トリ、ペンタ、又はヘブタメチン基を、L、液トリ、ベンタ、又はヘブタメチン基との上、後では、変トリ、元のサービが表数5~7のシクロアルケン環、シウロアルケンオン環、シクロアルケンオン環、シクロアルケンチン対塞を形成していてもよく、キノ

\*ンゼン環を形成していてもよい。X は対アニオンを示 す。〕

【0 2 2 】 ことで、式(IIIa)、(IIIb)、及び(IIIc)中の R<sup>\*</sup>、 R<sup>\*</sup>、 R<sup>\*</sup>、 及び R<sup>\*</sup> がアルキル基であるとき の炭素数は通常 1~15、 好ましくは 1~1 であり、 L たおける超快基としては、 同上炭素数のアルキル基、 アミノ基、 又はハロゲン原子等が挙げられ、 ピリリウム 環及びチアピリリウム環における置換基としては、 フェール基、 ナプチル基等のアリール基等が挙げられる。 【0 0 2 3】 又、ポリメチン系色素としては、 特に、 下記一般式(IV)で表されるものが好ましい。 【0 0 2 4】

ン環及びベンゼン環は置換基を有していてもよい。X は対アニオンを示す。〕

【0026】こで、式(IV)中のR"、R"、R"、及 びR"のアルキル基の炭素飲点道常1~15、好ましく は1~10、R"及びR"がアリール最であるときの炭 素数は通常6~20、好ましくは6~15であり、R" 及びR"として具体的には、フェニル基、1ーナフチル 基、2ーナフチル基、3・チェニル基等が挙げられ、それらの

置換基としては、同上炭素数のアルキル基、同上炭素数 のアルコキシ基、ジアルキルアミノ基、ヒドロキシ基、 又はハロゲン原子等が挙げられ、L' における置換基と しては、同上炭素数のアルキル基、アミノ基、又はハロ ゲン原子等が挙げられ、キノン環及びベンゼン環におけ る置換基としては、同上炭素数のアルキル基、同上炭素 数のアルコキシ基、ニトロ基、又はハロゲン原子等が挙\*

\* げられる。

【0027】更に、ジイミニウム系色素としては、特 に、下記一般式(Va)、又は(Vb)で表されるキノンジイミ ニウムが好ましい。

[0028]

(R.51

【0029】 (式(Va)、及び(Vb)中、R<sup>15</sup>、R<sup>16</sup>、 R"、R"、R"、R"、R"、及びR"は各々独立し て、水素原子、アルキル基、又はフェニル基を示し、キ 30 ノン環及びベンゼン環は置換基を有していてもよい。X は対アニオンを示す。尚、式(Vb)中の電子結合 (…) は他の電子結合との共鳴状態を示す。〕

【0030】 ここで、式(Va)、及び(Vb)中のキノン環及

びベンゼン環における置換基としては、炭素数が通常1 ~15、好ましくは1~10のアルキル基、炭素数が通 常1~15、好ましくは1~10のアルコキシ蒜、アシ ル基。ニトロ基、又はハロゲン原子等が挙げられる。 【0 0 3 1 】 尚. 前記一般式(Ia ~c)、(II)、(IIIa ~ c)、(IV)、及び(Va~b)における対アニオンX として 40 は、例えば、CI 、Br 、I 、ClO<sub>1</sub> 、PF 。 SbFe AsFe 及び BFI BC 1. 等の無機關素酸等の無機酸アニオン、並びに、ベ ンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、ナフタレンス ルホン酸、酢酸、及び、メチル、エチル、プロピル、ブ チル、フェニル、メトキシフェニル、ナフチル、フルオ ロフェニル、ジフルオロフェニル、ペンタフルオロフェ ニル、チエニル、ピロリル等の有機基を有する有機硼素

砂等の有機砂アニオンを挙げることができる。これらの 中で、硼酸アニオンを対イオンに有する色素は、塗布溶 **制に対する溶解性に優れるので、低沸点の溶剤の使用が** 可能となること等から、好ましい。

【0032】以上の前記一般式(la~c)で表されるキノ リン系、前記一般式(II)で表されるインドール系又はベ ンゾチアゾール系、前記一般式(IIIa ~c)で表されるピ リリウム系又はチアピリリウム系等のシアニン系色素、 前記一般式(IV)で表されるポリメチン系色素、及び前記 一般式(Va~b)で表されるジイミニウム系色素の中で、 本発明においては、前記一般式(II)で表されるインドー ル系又はベンゾチアゾール系色素が特に好ましい。

【0033】尚、前記一般式(la~c)で表されるキノリ ン系、前記一般式(II)で表されるインドール系又はベン ゾチアゾール系、前記一般式(IIIa ~c)で表されるピリ リウム系又はチアピリリウム系等のシアニン系色素、前 記一般式(IV)で表されるポリメチン系色素、及び前記一 般式(Va~b)で表されるジイミニウム系色素の各具体例 を以下に示す。

[0034]

[8:6]

[0035]

【化7】

(II- 2) 
$$\begin{array}{c} CH_3 CH_3 \\ CH=CH \rightarrow _{\overline{3}} CH \\ C_3H_6 \\ C_3H_6 \end{array}$$

(11-3) 
$$NO_2$$
  $CH_3$   $CH_3$ 

[0036]

特開2001-125282

16

15

(9)

[0037] 【化9】

$$\mathbf{B}^ \stackrel{\mathsf{P}}{\longleftrightarrow}$$
  $\stackrel{\mathsf{P}}{\longleftrightarrow}$   $\stackrel{\mathsf{P}}{\longleftrightarrow}$   $\stackrel{\mathsf{P}}{\longleftrightarrow}$ 

$$C_{2H_{5}}$$

$$C_{2H_{5}}$$

C104 -

[0038]

[0039] 40 [作1]

[0040]

【化12】

23

(11-11)

$$\begin{array}{c} C_2H_5 \\ \\ C_2H_5 \\ \end{array} \\ BF_4 \\ C_1 \\ C_2H_5 \\ C_2H_5 \\ C_3H_5 \\ C_3H$$

[0042] 【化14】

【化15】

[0043]

$$(IV-2) \qquad C1O_4 - CH-CH-CH-CH-C$$

$$(CH_{3})_{2}N + C = CH - CH = CH - C$$

$$(CH_{3})_{2}N + C = CH - CH = CH - C$$

$$(CH_{3})_{2}N + CH_{3}N +$$

$$(\text{CH}_{3})_{2}\text{N} \\ + \text{C} = \text{CH} + \text{CH} + \text{CH}_{\frac{1}{2}}\text{C} \\ + \text{CH}_{3})_{2}\text{N} \\ + \text{CH}_{3})_{3}\text{N}$$

$$(C_{2}H_{5})_{2}N \xrightarrow{C + CH + CH + CH + C} N^{*}(C_{2}H_{5})$$

[0044]

40 【化16】

$$(V-1) \begin{picture}(100,0) \put(0.5,0){\line(1,0){100}} \put(0.5,0){\line(1$$

[0046]本発射で伊生しいとするボン型感光性報度物における前記光熱変換物質の含有測合は、1~70個量象であるのが好ましく、2~60重量なであるのが好ましく。2~60重量なであるのが好ましい。[0046]又本持数であるのが好ながましい。表数を表する大熱変換物質とアルカリ可溶性樹脂を含有するボン型感光性組成物におけるアルカリ可溶性樹脂としては、例えば、ノボラック樹脂、レゾール樹脂、フェノール性水酸基を有するアクリル酸溶影体の共産体等が挙げられ、中で、ノボラック樹脂、レゾール樹脂、又はポリビニルフェノール樹脂を合作するのが好ましく、特に、ノボラック樹脂を含有するのが好ましく、特に、ノボラック樹脂を含有するのが好ましく、特に、ノボラック樹脂を含有するのが好ましく、特に、ノボラック樹脂を含有するのが好ましく、特に、ノボラック樹脂を含有するのが好ましく。

【0047】/ボラッグ樹脂は、例えば、フェノール、 ο ークレゾール、mークレゾール、pークレゾール、 の、5 ーキシレノール、3、5 ーキシレノール、の ーエ チルフェノール、mーエチルフェノール、pーエチルフ ェノール、プロピルフェノール、1ーナラルフェノー ル、tert1ーブチルフェノール、1ーナラトール、2 ーナフトール、4、4'ーピフェニルジオール・ピスフ ェノールーA、ピロカテニール、レゾルシノール、ハイ ドロキノン、ピロガロール、1。2、4 ーペンゼントリ オール、フロログルシノール等のフェノール類の少なく とも1 幅を、酸性触媒下、例えば、ホルムアルデヒド、 アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ベンズアル デヒドに代えてパラホルムアルデヒド後、高、ホルムア ルデヒドに代えてパラホルムアルデヒド後、用いても、いう、

又は、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプチ ルケトン等のケトン類、の少なくとも1額と車総合させ た樹脂であって、中で、本発明においては、フェノール 類としてのフェノール、ロークレゾール、ロークレゾール、 トラール、レブルシノールと、アルデヒド類又はケ トン類としてのホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、 30 プロピオンアルデヒドとの重総合体が好ましく、特に、 mークレゾール: pークレゾール: 2,5ーキシレノール 3、5ーキシレノール: レゾルシノールの混合割合 がモル比でdーの100:0~50:0~20:0~2 0:0~20の混合フェノール類、又は、フェノール: mークレゾール:pークレゾールの設合割合がモル比で 1~100:0~70:0~60 の混合フェノール類 と、ホルムアルデヒドとの直総合体が好ましい。

【0048】前記ノボラック樹脂は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー測定によるポリスチレン検算の 40 重版平均分子量(M・)が、好ましくは1,000~1 5,000、特に好ましくは1,500~10,000 のものが用いられる。

【0049】 X、レゾール樹脂は、ノボラック樹脂の理 給合における酸酸塩に代えてアルカリ触薬を用いる以外 は同様にして面緒合させた樹脂であって、本労卵におい ては、 前記ノボラック樹脂におけると同様の、フェノー が類などの混合組成、及び、アルデヒド紅又はケトン 類が好ましく、又、同様の電量平均分子量(M.) のも のが呼ましい。

【0050】又、ポリビニルフェノール樹脂は、例え

ば、a-ヒドロキシスチレン、m-ヒドロキシスチレ ン、p-ヒドロキシスチレン、ジヒドロキシスチレン、 トリヒドロキシスチレン、テトラヒドロキシスチレン、 ペンタヒドロキシスチレン、2-(0-ヒドロキシフェ ニル)プロピレン、2-(m-ヒドロキシフェニル)プ ロピレン、2-(n-ヒドロキシフェニル) プロピレン 等のヒドロキシスチレン類(尚、これらは、ベンゼン環 に塩素、臭素、沃素、弗素等のハロゲン原子、或いは炭 素数1~4のアルキル基を置換基として有していてもよ い。) の単独又は2種以上を、ラジカル重合開始剤又は 10 カチオン重合開始剤の存在下で重合させた樹脂であっ て、中で、本発明においては、ベンゼン環に炭素数1~ 4のアルキル基を置換基として有していてもよいヒドロ キシスチレン類の重合体が好ましく、特に、無置換のベ ンゼン環のヒドロキシスチレン類の重合体が好ましい。 【0051】前記ポリビニルフェノール樹脂は、又、一 部水素添加を行ったものでもよく、tertーブトキシ カルボニル基、ピラニル基、フリル基等で一部の水酸基 を保護したものでもよい。又、重量平均分子量 (Mr ) しくは1、500~50、000のものが用いられる。 【0052】ノボラック樹脂、レゾール樹脂、及びポリ ビニルフェノール樹脂の分子量が、前記範囲よりよりも 小さいとレジストとしての十分な途膜が得られず、前記 節囲よりも大きいとアルカリ現像液に対する溶解性が小 さくなり、露光部分の抜けが不十分となってレジストの パターンが得られにくくなる傾向となる。

【0053】本発明で好ましいとするポジ型感光性組成 物における前記アルカリ可溶性樹脂の含有割合は、30 ~99 重量%であるのが好ましく、40~98 重量%で 30 あるのが更に好ましく、50~97重量%であるのが特 に好ましい。

【0054】又、本発明において感光性組成物として好 ましいとする、前記光熱変換物質と前記アルカリ可溶性 樹脂を含有するボジ型感光性組成物には、露光部と非露 光部のアルカリ現像液に対する溶解性の差を増大させる 目的で、近赤外線領域の光で分解されない溶解抑止剤が 含有されていてもよい。

【0055】その溶解抑止剤としては、例えば、特開平 10-268512号公報に詳細に記載されているスル 40 ホン砂エステル類、燐砂エステル類、芳香族カルボン酸 エステル類、芳香族ジスルホン類、カルボン酸無水物 額、芳香族ケトン類、芳香族アルデヒド類、芳香族アミ ン類、芳香族エーテル類等、特開平11-190903 号公報に詳細に記載されている、ラクトン骨格、N. N ジアリールアミド骨格、ジアリールメチルイミノ骨格 を有する色素、特間平11-143076号公報に詳細 に記載されている、ラクトン骨格、チオラクトン骨格、 スルホラクトン骨格を有する色素等を挙げることができ る。

【0056】更に、溶解抑止剤として、例えば、ポリエ チレングリコール類、ポリエチレングリコールポリプロ ピレングリコールブロックコポリマー類、ポリエチレン グリコールアルキルエーテル類、ポリエチレングリコー ルポリプロピレングリコールアルキルエーテル類、ポリ エチレングリコールアルキルフェニルエーテル類、ポリ エチレングリコール脂肪酸エステル類、ポリエチレング リコールアルキルアミン類、ポリエチレングリコールア ルキルアミノエーテル類、ゲリセリン脂肪酸エステル及 びそのポリエチレンオキサイド付加物類、ソルビタン脂 肪酸エステル及びそのポリエチレンオキサイド付加物 類、ソルビット脂肪酸エステル及びそのポリエチレンオ キサイド付加物類、ペンタエリスリット脂肪酸エステル 及びそのポリエチレンオキサイド付加物類、ポリグリセ リン脂肪酸エステル類等の非イオン性界面活性剤が挙げ られる。

34

【0057】本発明で好ましいとするポジ型感光性組成 物における前記溶解抑止剤の含有割合は、50重量%以 下であるのが好ましく、0.01~30重量%であるの が、好ましくは1,000~100,000、特に好ま 20 が更に好ましく、0.1~20重量%であるのが特に好 ましい。

> 【0058】又、本発明において感光性組成物として好 ましいとする、前記光熱変換物質と前記アルカリ可溶性 樹脂を含有するポジ型感光性組成物には、アンダー現像 性の付与等、現像性の改良を目的として、好ましくはp K。が2以上の有機酸及びその有機酸の無水物が含有さ れていてもよい。

【0059】その有機酸及びその無水物としては、例え ば、特開昭60-88942号、特開昭63-2760 48号、特開平2-96754号各公報等に記載された ものが用いられ、具体的には、グリセリン酸、メチルマ ロン酸、ジメチルマロン酸、プロピルマロン酸、コハク 砂、リンゴ酸、メソ酒石酸、グルタル酸、βーメチルグ ルタル酸、β, β-ジメチルグルタル酸、β-エチルグ ルタル酸、β, β - ジェチルグルタル酸、β - プロピルグルタル酸、β、βーメチルプロピルグルタル酸、ピメ リン酸、スベリン酸、セバシン酸等の脂肪族飽和カルボ ン酸、マレイン酸、フマル酸、グルタコン酸等の脂肪族 不飽和カルボン酸、1、1-シクロブタンジカルボン 酸、1,3-シクロプタンジカルボン酸、1,1-シク ロペンタンジカルボン酸、1,2-シクロペンタンジカ ルボン酸、1、1-シクロヘキサンジカルボン酸、1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸、1,3-シクロヘキ サンジカルボン酸、1、4-シクロヘキサンジカルボン 酸等の炭素環式飽和カルボン酸、1,2ーシクロヘキセ ンジカルボン酸、2、3-ジヒドロキシ安息香酸、3, 4-ジメチル安息香酸、3、4-ジメトキシ安息香酸、 3. 5-ジメトキシ安息香酸、p-トルイル酸、2-ヒ ドロキシー p ートルイル酸、2 ーヒドロキシーm ートル 50 イル酸、2-ヒドロキシーo-トルイル酸、マンデル

総、没食子像、フタル像、イソフタル像、テレフタル酸 等の炭素照式不飽和カルボン酸、及び、メルドラム像 アスコルビン酸、無水コルウ酸、無水グルタル酸、無水 マレイン酸、シウロヘキセンジカルボン酸無水物、シク ロヘキサンジカルボン酸無水物、無水フタル酸等の無水 物を挙げることができる。

【0060】本発明で好ましいとするポジ型感光性組成物における前記有機像及びその無水物の含有割合は、30重量%以下であるのが好ましく、0.01~20重量%であるのが更に好ましく、0.1~10重量%であるのが特に好ましい。

[0061] 又、本秀明において悠光性和皮物として好 ましいとするポジ型感光性組成物には、前記成分以外 に、例えば、染料、前科、塗布性改良剤、密治性改良 剤、感度改良剤、感胎化剤等の感光性組成物に通常用い られる各種の添加剤が更に20重量%以下、好ましくは 10重量%以下の範囲で各者されていてもよい。

10年重売以下の報酬で含有されていてもます。 【0062】本列門において感光性相成物は、通常、各 構成成分を適当な溶媒に溶解した溶液として支持体表面 に塗布した後、加熱、乾燥することにより、支持体表面 に感光性層として形成され、感光性平版印刷版とされ

【0063】ここで、その溶媒としては、使用成分に対 して十分な溶解度を持ち、良好な途膜性を与えるもので あれば特に制限はないが、例えば、メチルセロソルブ、 エチルセロソルブ、メチルセロソルプアセテート、エチ ルセロソルプアセテート等のセロソルブ系溶媒、プロピ レングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコ ールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノブ チルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテ 30 ルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテ ルアセテート、プロピレングリコールモノブチルエーテ ルアセテート、ジプロピレングリコールジメチルエーテ ル等のプロピレングリコール系溶媒、酢酸ブチル、酢酸 アミル、酪酸エチル、酪酸ブチル、ジエチルオキサレー ト、ピルビン酸エチル、エチル-2-ヒドロキシブチレ ート、エチルアセトアセテート、乳酸メチル、乳酸エチ ル、3-メトキシプロピオン酸メチル等のエステル系溶 媒、ヘプタノール、ヘキサノール、ジアセトンアルコー ル、フルフリルアルコール等のアルコール系溶媒、シク 40 ロヘキサノン、メチルアミルケトン等のケトン系溶媒、 ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Nーメ チルピロリドン等の高極性溶媒、或いはこれらの混合溶 媒、更にはこれらに芳香族炭化水素を添加したもの等が 举げられる。溶媒の使用割合は、感光性組成物の総量に 対して、通常、重量比で1~20倍程度の範囲である。 【0064】又、その塗布方法としては、従来公知の方 法、例えば、回転途布、ワイヤーバー途布、ディップ徐 布、エアーナイフ塗布、ロール塗布、プレード塗布、及 びカーテン途布等を用いることができる。途布量は用途 50 により異なるが、乾燥順厚として、近常。  $0.3 \sim 7\mu$ ル 、 好ましくは $0.5 \sim 5\mu$  、 特に好ましくは $1 \sim 3$   $\mu$  mの範囲とする。尚、その際の乾燥温度としては、例 えば、 $6.0 \sim 1.70$  で程度、好ましくは $7.0 \sim 1.50$  で 程度、乾燥時間としては、例えば、 $5.9 \sim 1.0$  分間程 原、好ましくは $1.09 \sim 5.9$  作礼りなける

【0065】尚、画像形成時のコントラストの向上、及 び、画像形成性の経時安定性の向上等を目的として、例 えば、40~120℃程度、好ましくは40~70℃程 唐の温度で、5分~100時間程度、好ましくは30分 ~75時間程度の後加熱処理を施すことが好ましい。 【0066】又、その支持体としては、アルミニウム、 亜鉛、銅、鋼等の金属板、アルミニウム、亜鉛、銅、 鉄、クロム、ニッケル等をメッキ又は蒸着した金属板、 紙、樹脂を塗布した紙、アルミニウム等の金属箔を貼着 した紙、プラスチックフィルム、剱水化処理したプラス チックフィルム、及びガラス板等が挙げられる。中で、 好ましいのはアルミニウム板であり、塩酸又は硝酸溶液 中での電解エッチング又はブラシ研磨による砂目立て処 理、硫酸溶液中での陽極酸化処理、及び必要に広じて封 孔処理等の表面処理が施されたアルミニウム板がより好 ましい。又、支持体表面の組さとしては、IIS BO 601に規定される平均組さR,で、通常0、3~1. 0 μm、好ましくは0、4~0、8 μm程度である。 【0067】本発明の印刷版の製造方法は、支持体表面 に感光性組成物からなる感光性層が形成された感光性平 版印刷版の該感光性層を画像露光し、アルカリ現像液に て現像処理した後、水洗水にて水洗処理することよりな

【0068】ここで、感光性層を画像露光する光源とし ては、カーボンアーク、水銀灯、キセノンランプ、メタ ルハライドランプ、蛍光ランプ、タングステンランプ、 ハロゲンランプや、HeNeレーザー、アルゴンイオン レーザー、YAGレーザー、HeCdレーザー、半導体 レーザー、ルビーレーザー等のレーザー光源が挙げられ るが、特に、光を吸収して発生した熱により画像形成さ せる場合には、波長域650~1,300nmの範囲の レーザー光線を発生する光源が好ましく、例えば、ルビ ーレーザー、YAGレーザー、半導体レーザー、LED 等の固体レーザーを挙げることができ、特に、小型で長 寿命な半導体レーザーやYAGレーザーが好ましい。 【0069】尚、レーザー光源は、通常、レンズにより 集光された高強度の光線(ビーム)として感光性層表面 を走査するが、それに感応する本発明での感光性層の感 度特性 (m J / c m²) は受光するレーザービームの光 強度  $(m I / s \cdot c m^2)$  に依存することがある。ここ で、レーザービームの光強度は、光パワーメーターによ り測定したレーザービームの単位時間当たりのエネルギ 一量(m I / s)を感光性層表面におけるレーザービー ムの照射而積 (c m²) で除することにより求めること ができる。レーザービームの駅烙面積は、通常、レーザービーク強度の1/e<sup>2</sup> 強度を超える部分の面積で定義されるが、簡易的には相反則を示す感光性組成物を感光させて測定することもできる。

【0070】 本発明において、光深の光強度としては、 2.0×10° mJ/s · c · m² 以上とすることが好ま しく、1,0×10° mJ/s · c · m² 以上とすること が特に好ましい。光強度が前記範囲であれば、本発明で の感光性層の感度特性を向上させ得る、走査解光時間を 超くすることができ実用的に大き数利点となる

[0071] 又、本発則において、レーザー光統により 両像露光する場合、外面ドラム走査露光、内面ドラム走 査露光、平面走査露光等の台露光方式を用いることがで きる。これもの響光方式の中では、高解像度で高精細な 画像が形成できる点から外面ドラム又は内面ドラム走査 磁光方式が戻せよい。

【0072] 感光性層を画像需光した後、現像処理に用いる現像液としては、露光部と非露光部との溶解性等の差で現像し得るアルカリ現像でもればよいが、銀水性の面から、アルカリ金属の水酸化物とアルカリ金属の建 20 後地とを含する水溶液であるのが好ましく、そのアルカリ金属の建酸起が、二億化珪末としての含有量で0.5~5年間地、特には1.0~4.0 垣屋%であるのが好ましい。又、非両像部の抜り性の面から、そのpⅡは12.0以上、更には12.5以上、特には13.0以上であるのが好ましい。

【0073】 ここで、アルカリ剤としてのアルカリ金属の水酸化物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化ルチウム等が率げられ、又、アルカリ金属の年誌数 Lとしては、珪酸ナリウム、珠酸カリウム、珪酸 30リチウム等が挙げられる。

【0074】又、本発明におけるアルカリ現像液は、現像条件の幅を広げ得る広から、シリコーン類を含有するものであるのが好ましく、その含有量としては、1~10,000ppmであるのが好ましい。

[0075] こで、シリコーン類としては、シロキサン結合を得格とし、具体的には、例えば、ジメナルポリシ にキウンはそのメチル基の一部が水素又はフェニル 基で置換された主鎖を持つシリコーンオイル、シリコー 40 レジン等の中で、溶液型、エマルジョン型、及びコンパウンド型等として用いられているシリコーンメイルが 好ましく、中で、消泡剤として用いられているものが好ましく、更に、ジメチルポリシロキサンとポリアルキレンオキサイドとの共重合体のような自己乳化型の銀水性を看するものが特に好ましい。

【0076】更に、本発明におけるアルカリ現像液は、 現像条件の幅を安定して広げ得る点から、カチオン性、 アニオン性、ノニオン性、或いは両性界面活性剤を含有 するものであるのが好ましく、その含有量としては、1: 0~50,000ppm、特には100~5,000ppmであるのが好ましい。

【0077】 ことで、カテオン性界面活性剤としては、 具体的には、例えば、ラウリルトリメチルアンモニウム クロライド、セチルトリメチルアンモニウムクロライド、ベ ベニルトリメチルアンモニウムクロライド、ベ ベニルトリメチルアンモニウムクロライド、ジステアリ ルジメチルアンモニウムクロライド、パーフルオロトリ メチルアンモニウムクロライド、ラウリルピリジーウム 10 クロライド等の第4級アンモニウム塩類、2ーオクタデ シルーヒドロキシエチルー2ーイミダソリン等のイミダ ゾリン誘導体類、N、Nージエチルーステアロアミドー メチルアミン塩酸塩、ポリオモメチレンステアロアミドー メチルアミン塩酸塩、ポリオエチレンステアロアミドー メチルアミン塩酸塩、ポリオエチレンステアロアミン塩酸サミン塩酸セラミン塩酸等を着いるとかできる。

【0078】又、アニオン性界面活性剤としては、ラウ リン酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、オレイン 酸ナトリウム等の高級脂肪酸塩類、ラウリル硫酸ナトリ ウム、ステアリル硫酸ナトリウム等アルキル硫酸エステ ル塩額、オクチルアルコール硫酸エステルナトリウム、 ラウリルアルコール硫酸エステルナトリウム、ラウリル アルコール硫酸エステルアンモニウム等の高級アルコー ル硫酸エステル塩類、アセチルアルコール硫酸エステル ナトリウム等の脂肪族アルコール硫酸エステル塩類、ド デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム等のアルキルベン ゼンスルホン酸塩類、イソプロピルナフタレンスルホン 酸ナトリウム等のアルキルナフタレンスルホン酸塩類、 アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム等 のアルキルジフェニルエーテルジスルホン酸塩類、ラウ リル燐酸ナトリウム、ステアリル燐酸ナトリウム等のア ルキル燐酸エステル塩類、ラウリルエーテル硫酸ナトリ ウムのポリエチレンオキサイド付加物、ラウリルエーテ ル硫酸アンモニウムのポリエチレンオキサイド付加物、 ラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミンのポリエチ レンオキサイド付加物等のアルキルエーテル硫酸塩のポ リエチレンオキサイド付加物類、ノニルフェニルエーテ ル硫酸ナトリウムのポリエチレンオキサイド付加物等の アルキルフェニルエーテル硫酸塩のポリエチレンオキサ イド付加物類、ラウリルエーテル燐酸ナトリウムのポリ エチレンオキサイド付加物等のアルキルエーテル燐酸塩 のポリエチレンオキサイド付加物類、ノニルフェニルエ ーテル燃砂ナトリウムのポリエチレンオキサイド付加物 等のアルキルフェニルエーテル燐酸塩のポリエチレンオ キサイド付加物額等を挙げることができる。

【0079】 X、ノニオン性界両部性剤としては、ポリ エチレングリコール、ポリエチレングリコールポリプロ ピレングリコールプロックコポリマー等のポリエチレン グリコール類、ポリエチレングリコールセチルエーテル、ポリ エチレングリコールステアリルエーデル、ポリ リコールオレイルエーテル、ポリエチレングリコール アルキルエーテル類、ポリエチレングリコールポリプロ ピレングリコールヤチルエーテル、ポリエチレングリコ ールポリプロピレングリコールデシルテトラデシルエー テル等のポリエチレングリコールポリプロピレングリコ ールアルキルエーテル類、ポリエチレングリコールオク チルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールノニル フェニルエーテル等のポリエチレングリコールアルキル フェニルエーテル類、モノステアリン酸エチレングリコ ール、ジステアリン酸エチレングリコール、ステアリン 酸ジエチレングリコール、ジステアリン酸ポリエチレン 10 グリコール、モノラウリン酸ポリエチレングリコール、 モノステアリン酸ポリエチレングリコール、モノオレイ ン酸ポリエチレングリコール等のポリエチレングリコー ル脂肪酸エステル類、モノミリスチン酸グリセリル、モ ノステアリン酸グリセリル、モノイソステアリン酸グリ セリル、ジステアリン酸グリセリル、モノオレイン酸グ リセリル、ジオレイン砂グリセリル等のグリセリン脂肪 酸エステル類、及びそのポリエチレンオキサイド付加物 類、モノパルミチン酸ソルビタン、モノステアリン酸ソ ルビタン、トリステアリン酸ソルビタン、モノオレイン 20 酸ソルビタン、トリオレイン酸ソルビタン等のソルビタ ン脂肪酸エステル類、及びそのポリエチレンオキサイド 付加物類、モノラウリン酸ソルビット、テトラステアリ ン酸ソルビット、ヘキサステアリン酸ソルビット、テト ラオレイン酸ソルビット等のソルビット脂肪酸エステル 類、及びそのポリエチレンオキサイド付加物類、ヒマシ 油のポリエチレンオキサイド付加物類等を挙げることが できる。

【0080】又、両性界面活性剤としては、NーラウリルーN、NージメチルーNーカルボキシメチルアンモニ 30 カ、 アージメチルーNーカルボキシメチルアンモニウム、NーラウリルーN、Nージ・リンモニウム、NーラウリルーN、Nートリス(カルボキシメチルアンモニウム、NーラウリルーN、N、トーリス(カルボキシメチル)アンモニウム等のベタイン型化合物類、2ーアルキルーNーカルボキシメチルーNーとドコキシエチルイミダソリウムがヘミダソリク上級類、イミダソリンーNーナトリウムエチルスルコェート等のイミダゾリンが開きを挙げることができる。 40

[0081]以上の界面活性剤の中で、本発明において は、カチオン性界面活性剤としての前記剤 4級アンモニ ウム塩類、ノニオン性界面活性剤としての前記名種のポリエチレングリコール誘導体類、前記名種のポリエチレンオキサイド付加物質等のポリエチレンオキサイド誘導 体類、両性界面活性剤としてのペタイン型化合物類が好ましい。

【0082】尚、本発明におけるアルカリ現像液には、 前記アルカリ剤、前記シリコーン類、前記界面活性剤の 外に、必要に応じて、更に、硬水軟化剤、pH調整剤、 消泡剤等の添加剤を含有させることができる。これらの 添加剤は、アルカリ現像液中に、好ましくは0.001 ~5重量%、特に好ましくは0.005~3重量%の濃 度で含有させることができる。

【0083】尚、現像処理は、浸漬現像、スプレー現像、ブラシ現像、超音液現像等により、好ましくは10~50℃程度、特に好ましくは20~40℃程度の温度でなされる。

【0084】本等側において、現像処理した後、現像放在 充弦が流すための水洗処理を、消泡剤を含有する水洗水で行うことを必須とし、その含有量としては、10~10,000pmであるの対算ましい。消溶剤を含有しない場合には、印削版として、非価値能での列入、及び両像部でのインキ付着不良による白抜け等がない印刷物を安定して得るという・一般が変更ない。一方、多過ぎても同様の側向となる。尚、水流に消泡粉集合含させることによる木発明の効果は、アルカリ現像波が界面活性剤を前述の対策しい範囲で含有するものであるとき、特に觸索となる。

【0085】ここで、消泡剤としては、ヒマシ油、亜麻 仁油等の油脂系、ステアリン酸、オレイン酸等の脂肪酸 系、天然ワックス等の脂肪酸エステル系、ポリオキシア ルキレンモノハイドリックアルコール等のアルコール 系、ジー t ーアミルフェノキシエタノール、ヘプチルセ ロソルブ、ノニルセロソルブ、3-ヘプチルカルビトー ル等のエーテル系、トリプチルフォスフェート、トリス (プトキシエチル) フォスフェート等の機能エステル 系、ジアミルアミン等のアミン系、ポリアルキレンアミ ド、アシレートポリアミド等のアミド系、ステアリン酸 アルミニウム、ステアリン酸カルシウム、オレイン酸カ リウム、羊毛オレイン酸のカルシウム塩等の金属石鹸 系、ラウリル硫酸エステルナトリウム等の硫酸エステル 系、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロ キサン、メチル水素ポリシロキサン、フロロポリシロキ サン、ジメチルポリシロキサンとポリアルキレンオキサ イドとの共重合体等のシリコーンオイル、及びその溶液 型、エマルジョン型、ペースト型シリコーンオイル等の シリコーン系の消泡剤が挙げられるが、中で、シリコー 40 ン系消泡剤が好ましい。

【0086】又、水洗水としては、日本国水道は、保和 32年法律第177岁)及びそれに基づ、水質基準に関 する省令(傾和53年8月31日厚生等の第56号)、 同国温泉法(昭和23年7月10日法律第125号及び その別投)、及び、WHO規定水道水基準によって規定 される水中の組入の状態に於りる名元素やミネシル等へ の影響、等に基づくものが好ましく、更に、本発明の効 果の達成をより確実にするために、カルシウム濃度が、 接酸カルシウムとしての濃度として、0.001~20 00pmであるのが好ましく、0.01~150ppm

であるのが更に好ましく、0.05~10ppmである のが特に好ましい。

【0087】又、水洗水としては、本発明の効果の達成 をより確実にするために、キレート形成性化合物を含有 するものであるのが好ましく、その含有量としては、 0.001~15重量%であるのが好ましく、0.00 5~10重量%であるのが更に好ましく、0.01~5 重量%であるのが特に好ましい。

【0088】ここで、キレート形成性化合物としては、 特に限定されるものではないが、酸性基を有するアミン 10 又はその誘導体類が特に好ましい。その酸性基を有する アミンとしては、脂肪族、脂環式、又は芳香族炭化水素 アミンであり、モノアミンに限定されず、ジアミン、ト リアミン等のポリアミンであってもよく、又、第1アミ ン、第2アミン、第3アミンのいずれであってもよい が、カルボキシル基、スルホン基、燐酸基、フェノール 基等の酸性基、好ましくはカルボキシル基を、1個以 上、好ましくは、アミノ基と同数以上有する化合物であ って、その酸性基が、アンモニウム塩や、ナトリウム、 カリウム等の金属塩等の塩、炭素数1~4のアルキルエ 20 ステル等のエステル等を形成した誘導体であってもよ く、更に、水酸基、カルボニル基、アリール基、ハロゲ ン原子等の置換基を有していてもよい。又、その分子量 は、2.000以下であるのが好ましく、1.000以 下であるのが更に好ましい。

【0089】本発明におけるこれらの、酸性基を有する アミン又はその誘導体類としては、具体的には、例え ば、エチレンジアミンモノ酢酸、エチレンジアミンジ酢 酸、エチレンジアミントリ酢酸、エチレンジアミンテト ラ酢酸、アミノ酪酸、アスパラギン酸、ゲルタミン酸、 ラウリル-β-イミノジプロピオン酸、システイン酸、 N-フェニルグリシン、フェニルアラニン、N-フェニ ルアラニン、チロシン、エチルアニリノジ酢酸等、及 び、それらのナトリウム、カリウム等の金属の部分塩、 アンモニウムの部分塩、部分メチルエステル、部分エチ ルエステル等の誘導体等が挙げられ、中でも、エチレン ジアミンテトラ酢酸又はその金属塩、アスパラギン酸や グルタミン酸等のモノアミノジカルボン酸又はその金属 塩が好ましく、エチレンジアミンテトラ酢酸又はその金 属塩が特に好ましい。尚、ここで、「部分」とは、各化 40 合物中に存在する全カルボキシル基ではない状態であっ て、各化合物における平均値を言い、必ずしも自然数に 限定されるものではない。

【0090】本発明において、前記水洗水による水洗処 理は、通常、水洗水槽を用い、現像処理した印刷版を槽 中の水洗水に浸漬する方法、現像処理した印刷版面に槽 上で水洗水をシャワー又はスプレー等により液滴状で供 給する方法等により施されるが、中で、印刷版面に水洗 水を液滴状で供給する方法によるのが好ましい。又、水 洗水槽中の水洗水は、非循環方式、或いは、水洗水を水 50 剤(第一工業製薬社製「アモーゲンK」)を3,000

洗水槽に戻すか、水洗水を印刷版面上に供給する形で水 洗水槽に戻す等の循環方式のいずれであってもよいが、 水洗水を循環させながら水洗する循環方式で、特には、 水洗水を印刷版面上に供給する形で水洗水槽に戻す循環 方式で、水洗水を印刷版面に液滴状で供給する方法にお いて、本発明の効果を顕著に発現させ得ることとなる。 【0091】尚、水洗水の温度は、通常10~40℃、 好ましくは15~35℃、更に好ましくは20~30 ℃、水洗時間は、通常2~120秒、好ましくは5~6 ①秒、更に好ましくは10~45秒である。

42

【0092】本発明の印刷版の製造方法は、前記水洗処 理を必須とするが、水洗処理後、アラビアゴム、デキス トリン類、カルポキシメチルセルロース類、燐酸等を含 有する版面保護液を版面に塗布し、乾燥させるガム引き 処理を施してもよい。

[0093] 【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに具体的に 説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の

実施例に限定されるものではない。 実施例1~6、比較例1

アルミニウム板 (厚さ0, 24mm) を、3重量%水酸 化ナトリウム浴中で60℃で1分間脱脂処理を行った 後、12g/リットルの濃度の塩酸浴中で25℃、80 A / d m<sup>2</sup> の電流密度で10秒間電解エッチング処理を 行い、水洗後、10g/リットルの濃度の水酸化ナトリ ウム浴中で50℃で3秒間デスマット処理し、水洗後、 30重量%硫酸浴中で30℃、10A/dm<sup>2</sup>の電流密 度で15秒間隔極酸化処理を行った。更に、90℃、p H9にて熱水封孔処理し、水洗、乾燥して平版印刷版支 持体用のアルミニウム板を作製した。

【0094】得られたアルミニウム板支持体表面に、光 熱変換物質として、前記具体例(II-8)で示したインドー ル系色素(日本化薬社製、「С Y-10」)4重量部、 アルカリ可溶性樹脂として、フェノール/m-クレゾー ル/p-クレゾール=50/30/20 (モル比) の混 合フェノールをホルムアルデヒドで重縮合したノボラッ ク樹脂(M, 9, 400、住友デュレズ社製、「SK-1881) 100重量部、溶解抑止剤として、ポリエチ レングリコール (東邦化学工業社製、「PEG#200 0」) 4重量部、及び、現像性改良剤として、1,2-シクロヘキサンジカルボン酸5重量部とを、メチルセロ ソルプ1.000重量部に溶解した塗布液をワイヤーバ 一を用いて塗布し、乾燥させることにより、乾燥膜厚が 2. 5 g/m のポジ型感光性組成物からなる感光性層 を有するポジ型感光性平版印刷版を作製した。

【0095】一方、現像液として、珪酸カリウム2.8 30kgと水酸化カリウム0、712kgを水46、4 58kgに溶解して二酸化珪素としての含有量を1.5 重量%となし、更に、ベタイン型化合物の両件界面活件 43

p pm、シリコーン類(ダウコーニングアジア社製「F Sアンチフォーム801)を300ppm添加したpH 13.3のアルカリ水溶液を作製し、又、水洗水とし て、カルシウム濃度140nnmの水道水(実施例1~ 5、比較例1)、又は、カルシウム濃度0.1ppmの 脱イオン水(実施側6)に、それぞれエチレンジアミン テトラ酢砂2ナトリウム塩を0.1重量%添加し、更 に、表1に示す濃度となるように、シリコーン系消泡剤 (ダウコーニングアジア社製「FSアンチフォーム8 01)の3重量%水溶液を加えて(実施例1~6) 又は 10 加えずして(比較例1)、水洗水を作製した。

【0096】前記で得られたポジ型感光性平版印刷版 を、レーザー露光機(Creo社製、「Trendse tter」)で200mi/cm<sup>2</sup>で画像露光した後、 自動現像機(米国ウェスタンリソテック社製「Diam ond Plate Processor1271) & 用い、その現像液槽(容量60リットル)に前記で作製 した現像液を入れ、現像液の温度を34℃として、スプ レー現像法により60秒間の現像処理を施した後、同自 動現像機内の水洗水槽(容量20リットル)に、前記で\*20

\*作製した各水洗水20リットルを入れ、更に、印刷版を 多量に処理した場合に準じた状態とするために現像液 1 2リットルを入れて、オーバーフローした容量以上分を 循環させながら、水洗水の温度を26℃として、版面に 水洗水を25秒間スプレーすることにより水洗処理し、 勢風乾燥して各ポジ型平版印刷版を作製した。

【0097】その水洗処理時の泡沫の発生状況を観察 L. 以下の基準で評価L、結果を表1に示した。 (): 泡沫の発生なし。

人:僅かの泡沫が発生するが、水洗水槽からの流出はな

×;大量の泡沫が発生し、水洗水槽からの流出あり。 【0098】引き続いて、得られた各ポジ型平版印刷版 を、枚葉印刷機 (三菱重工社製) にかけて印刷試験を行 い、非画像部での汚れ、及び、画像部でのインキ付着不 良による白抜け等の発生状況の有無を観察し、結果を表 1に示した。

[0099]

【表1】

	水洗水		水洗処理	印刷結果	
	カルシウム 濃度(ppm)	消泡剤濃度 (ppn)	泡沫 発生状況	非国像部 汚れ	画像部白抜け
実施例1	140	4 5	0	無	無
実施例2	140	150	0	無	無
実施例3	140	450	0	無	無
実施例4	140	1500	0	無	無
実施例 5	140	5	Δ	若干有	無
実施例 6	0.1	45	0	無	無
比較例1	140	0	×	多数有	無

[0100] 【発明の効果】本発明によれば、非画像部での汚れ、及 び画像部でのインキ付着不良による白抜け等がない印刷

物を安定して得ることができる印刷版の製造方法を提供 することができる。